فر آیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۱۲، شماره ۴، زمستان ۹۷

ایجاد پوشش کامپوزیتی YSZ/AI بر روی سوپرآلیاژ اینکولوی ۸۲۵ به روش رسوب دهی الکتروفورتیک

هجتبی احمدی^۱، حسین آقاجانی^۲،* ۱- فارغالتحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲- دانشیار، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران *عهده دار مکاتبات: h_aghajani@tabrizu.ac.ir (تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲، تاریخ پذیرش:۱۳۹۷/۰۲/۱۴)

چکیده: در این پژوهش، شرایط ایجاد پوشش کامپوزیتی YSZ/AI بر روی سوپر آلیاژ اینکولوی ۸۲۵ به روش رسوب دهی الکتروفور تیک مورد مطالعه قرار گرفته است. پایداری سوسپانسیون ذرات YSZ و AI در استون و در حضور پراکنده ساز ید با اندازه گیری اندازه ذرات موجود در سوسپانسیون و پتانسیل زتا مطالعه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سوسپانسیون حاوی g/l ۱/۲ ید به منظور رسوب دهی الکتروفور تیک هم زمان دو پودر انتخاب شد. میانگین اندازه ذرات ZSZ و AI در این سوپانسیون ۱/۲ ید به منظور رسوب دهی الکتروفور تیک هم زمان دو پودر انتخاب شد. میانگین اندازه ذرات ZSZ و AI در این سوپانسیون به تر تیب برابر mn ۶۱۱/۹ و mμ ۸۶/۵۷ و مقدار پتانسیل زتا برای دو پودر به تر تیب برابر ۲۰/۵ و ۳۸ اندازه گیری شد. به منظور بررسی تاثیر ولتاژ اعمالی و زمان رسوب دهی بر روی کیفیت رسوب تشکیل شده از لحاظ یکنواختی و وجود یا عدم وجود ترک، رسوب دهی در ولتاژها و زمان مای موب دهی مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که رسوب تشکیل شده در ولتاژ و جود ترک، رسوب دهی در ولتاژها و زمان مای رسوب دهی مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که رسوب تشکیل شده در ولتاژ پوشش دارای ضخامت MI کاری دام در ای سوب دهی مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که رسوب تمکیل شده در ولتاژ

واژەھاي كليدى:

YSZ، آلومينيوم، رسوبدهي الكتروفور تيك، پتانسيل زتا.

۱- مقدمه

(۲) نداشتن استحاله فازی در محدوده دمای اتاق تا دمای کار کرد، (۳) هدایت حرارتی کم، (۹) خنثی بودن شیمیایی، (۵) تطابق ضریب انبساط حرارتی با زمینه فلزی، (۹) چسبندگی مناسب با زمینه فلزی و (۷) نرخ تفجوشی کم ریزساختار متخلخل. این ویژگیها باعث شده است تا تعداد موادی که در این زمینه می توانند به کار روند، محدود شود [۴]. رایج ترین ماده برای ایجاد پوششهای سد حرارتی، زیرکونیای پایدار شده با ایتریا ایتریا (YSZ) است که شامل زیرکونیای آلاییده شده با ایتریا است [1].

پوشش های سد حرارتی گروهی از پوشش های سرامیکی هستند که بر روی سطح سوپر آلیاژ اعمال می شوند و دمای کار موتور را افزایش می دهند. این پوشش ها از رسیدن دمای سوپر آلیاژ به نقطه ذوب جلوگیری کرده و همچنین از آن در برابر خستگی و خزش حرارتی و اثرات اکسیدکننده سولفات ها و ترکیبات حاوی اکسیژن دیگر در گازهای احتراقی حفاظت می کنند. مهم ترین نقش این پوشش ها کاهش دمای زیر لایه است [۱–۳]. مواد مورد استفاده در پوشش های سد حرارتی باید ویژگی هایی داشته باشند که مهم ترین آن ها عبارتند از: (۱) نقطه ذوب بالا،

روش های مختلفی برای اعمال پوشش های YSZ به کار گرفته شده است که از جمله آن ها می توان به رسوب دهی الکتروشیمیایی فاز بخار^۱ [۵]، رسوب دهی شیمیایی فاز بخار^۱ [۶]، رسوب دهی فیزیکی فاز بخار^۳ [۷]، رسوب دهی پاششی الکترواستاتیک^۴ [۸]، فرآیند سل ژل^۵ [۹] و رسوب دهی الکتروفور تیک⁶ [۱۰] اشاره کرد. در میان این روش ها، روش EPD به دلیل ساده بودن تجهیزات، زمان کم فرآیند پوشش -دهی، امکان پوشش دهی قطعات با شکل های هندسی پیچیده و کنترل آسان ضخامت پوشش مورد توجه قرار گرفته است

روش EPD یکی از فرآیندهای کلوئیدی در ساخت سرامیک -هاست که در تولید پوششهای متراکم با ضخامتهای مختلف به کار میرود. در فرآیند EPD، ذرات پودری باردار که در یک محیط مایع پایدار یا معلق شدهاند، با اعمال میدان الکتریکی بر روی یک زمینه رسانا با بار الکتریکی مخالف رسوب داده می -شوند [11]. شکل (۱) طرحوارهای از فرآیند رسوبدهی الکتروفورتیک را نشان میدهد.



شکل (۱): طرحوارهای از سیستم رسوبدهی الکتروفورتیک [۱۴]

به طور معمول، پس از فرآیند رسوبدهی الکتروفورتیک انجام عملیات حرارتی متناسب با خواص پوشش مورد نیاز است تا

تراکم ذرات و چسبندگی مناسب پوشش و زمینه حاصل شود. دمای عملیات حرارتی باید در حدی باشد که تفجوشی ذرات پوشش سرامیکی اتفاق بیفتد. یکی از مشکلات عملیات حرارتی تفجوشی پس از فرآیند EPD این است که دمای تفجوشی به طور معمول، بیش از 2°۲۰۰ است و این دمای بالا در اغلب موارد باعث آسیب رسیدن به زمینه فلزی می شود. یکی از روش-های رایج برای کاهش صدمات ناشی از عملیات حرارتی تف جوشی استفاده از برخی مواد کمک سینتر است که باعث کاهش دمای تفجوشی ذرات سرامیکی می شوند. یکی از افزودنی های کمک سینتر که می تواند در کاهش دمای تفجوشی پوشش زوب پایین می توانند در حین عملیات حرارتی تف بهبود رفتار سینترینگ ذرات SYZ و ایجاد پوشش متراکم در دمای پایین تری شوند [۵–۱۶].

در این پژوهش شرایط رسوبدهی الکتروفورتیک پوشش کامپوزیتی YSZ/AI از حلال استون و در حضور پراکندهساز ید بررسی شده است. بدین منظور ابتدا ترکیب سوسپانسیون پایدار برای هر دو پودر مطالعه شده و سپس شرایط رسوبدهی مناسب برای ایجاد پوشش کامپوزیتی حاوی دو پودر مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- مواد و روش انجام تحقيق

در این پژوهش از پودر -Aldrich Y2O3, Sigma % ما 3 mol% Y2O3, Sigma و پودر (Aldrich با خلوص ۹۹٪ و میانگین اندازه ذرات ۵۰ nm و پودر آلومینیوم (Sigma-Aldrich) با خلوص ۹۹٪ به شکل پولکی و با اندازه ذرات μm ۲-۱۰ به عنوان مواد اولیه پوشش استفاده شد. همچنین از ید (Carlo Erba) با خلوص ۹۹٪ به عنوان پراکنده ساز و استون (دکتر مجللی) با خلوص ۹۹٪ به عنوان حلال استفاده شد.

به منظور به دست آوردن سوسپانسیون مناسب برای رسوبدهی هم زمان پودرهای YSZ و آلومینیوم، ابتدا پایداری سوسپانسیون حاوی پودرهای مذکور به صورت جداگانه و در حضور مقادیر

مختلف ید بررسی شد. برای این منظور، سوسپانسیونهایی با غلظت پودر اولیه ۱۰ g/۱ حاوی مقادیر مختلف ۰/۴، ۸/۱، ۲/۱، ۱/۶ و 2/1 ۲ در استون تهیه شد. به منظور اندازه گیری میانگین اندازه ذرات و پتانسیل زتا برای هر سوسپانسیون از دستگاه زتامتر استفاده شد.

رسوب دهی الکتروفور تیک بین زمینه سوپر آلیاژ اینکولوی ۸۲۵ با ابعاد ۳ mm ×۲۱×۱۲ به عنوان کاتد که در بین دو الکترود فولاد زنگ نزن با ابعاد ۱ mm ۲×۳۰×۲۰ به عنوان آند و به فاصله ۱ m از هر کدام قرار گرفته بود، انجام گرفت. رسوب دهی در ولتاژهای مختلف ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۷ ۱۵ و زمان های رسوب دهی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ دقیقه انجام گرفت. سپس نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت در محیط آزمایشگاه خشک شدند. به منظور بررسی تغییرات وزن پوشش با ولتاژ و زمان رسوب دهی، وزن هر نمونه یک بار قبل از رسوب دهی و یک بار پس از رسوب دهی اندازه-گیری شد و وزن پوشش از تفاضل وزن نمونه ها قبل و بعد از رسوب دهی محاسبه شد. بررسی کیفیت پوشش های خام ایجاد شده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد.

۳- نتايج و بحث

پایداری سوسپانسیون یکی از عوامل مهم و کلیدی در فرآیند رسوب دهی الکتروفور تیک است. برای به دست آوردن پوشش کامپوزیتی Al/YSZ با استفاده از روش رسوب دهی الکتروفور تیک باید سوسپانسیونی تهیه شود که هر دو پودر Al و YSZ در آن پایدار باشند تا امکان رسوب دهی هم زمان آنها وجود داشته باشد. بنابراین، ابتدا رفتار ذرات Al و YSZ به طور جداگانه در استون و در حضور مقادیر مختلف ید بررسی شد تا با تلفیق نتایج به دست آمده، ترکیب مناسب سوسپانسیون برای پایدارسازی و رسوب دهی هم زمان دو پودر تعیین شود. برای این منظور، سوسپانسونهایی با ترکیب I/ ۱۰ پودر و حاوی مقادیر مختلف ۲/۰، ۲/۱، ۲/۱، ۱۶/ و I/۶ ۲ ید تهیه شد.

مقدار ید را نشان می دهد. نیروی وزن ذرات موجود در سوسپانسیون باعث تهنشینی ذرات و عدم پایداری سوسپانسیون می شود. بنابراین اگر نیروی دافعه کافی بین ذرات ایجاد نشود، ذرات از طریق نیروی جاذبه واندروالسی به هم متصل شده و آگلومرههای درشتی را در داخل سوسپانسیون تشکیل می دهند. در نتیجه، در اثر تشکیل آگلومره، نیروی وزن ذرات افزایش یافته و سوسپانسیون ناپایدار می شود. بنابراین، جلوگیری از تشکیل آگلومره و رسیدن به اندازه ذرات کوچکتر در داخل سوسپانسیون یکی از شروط لازم و اساسی برای به دست آوردن این نمودار میانگین اندازه ذرات برای سوسپانسیون بدون این مقدار کوچکتر می شود و در ا/g ۲/۱ به مقدار ا/p ۲/۱ این مقدار کوچکتر می شود و در ا/g ۲/۱ به مقدار مات اوزایش اندازه متوسط ذرات موجود در سوسپانسیون باعث



شکل (۲): نمودار میانگین اندازه ذرات YSZ در استون بر حسب مقدار ید

پارامتر دیگری که نقش مهم و کلیدی در پایداری سوسپانسیون دارد، پتانسیل زتا است. به عبارت دیگر، اندازه ذرات کوچک تر و پتانسیل زتای بیش تر دو شرط اساسی برای پایدارسازی سوسپانسیونهای به کار رفته در فرآیند EPD هستند. شکل (۳) مقدار يد نشان مي دهند.

نمودار تغییرات پتانسیل زتا بر حسب مقدار ید را برای سوسپانسیون نانوذرات YSZ در استون نشان میدهد. طبق این نمودار با افزایش مقدار ید تا ۱/۲ g/l مقدار پتانسیل زتا افزایش می یابد که نشاندهنده افزایش بار سطحی ذرات است. اما در مقادیر بیش تر از ۱/۲ g/l مقدار پتانسیل زتا و بار سطحی ذرات کاهش می یابد.



شکل (۳): نمودار تغییرات پتانسیل زتا بر حسب مقدار ید برای سوسپانسیون نانوذرات YSZ در استون

دلیل این رفتار به تجمع یونهای ⁺H در سطح ذرات برمی گردد. در اثر افزودن ید به سوسپانسیون با حلال استون، یونهای ⁺H طبق واکنش (۱) تولید می شوند.

$$CH_{3}COCH_{3} + 2I_{2} \leftrightarrow ICH_{2}COCH_{2}I + 2H^{+} + 2I^{-}$$
(1)

در بیش تر مواقع، سطح ذرات YSZ دارای گروههای هیدروکسیل است که از رطوبت هوا جذب شده است. این گروههای هیدروکسیل، یونهای ⁺H را جذب میکنند و این امر باعث ایجاد بار مثبت در سطح ذرات YSZ می شود. با افزایش مقدار ید تعداد یونهای ⁺H تولید شده افزایش یافته و در نتیجه بار ایجاد شده در سطح ذرات YSZ افزایش مییابد. بنابراین

افزایش مقدار ید تا ا/g ۱/۲ باعث کاهش آگلومره شدن و اندازه متوسط ذرات و افزایش بار سطحی و پتانسیل زتا میشود. اما وقتی تعداد این یونها بیش از حد افزایش یابد، به دلیل به هم فشردگی لایه دوگانه الکتریکی، ذرات آگلومره شده و پتانسیل زتا کاهش مییابد [۱۷]. شکلهای (۴) و (۵) به ترتیب نمودارهای اندازه متوسط ذرات و مقدار پتانسیل زتا را برای ذرات آلومینیوم در استون بر حسب



شکل (۴): نمودار اندازه متوسط ذرات AI در استون در حضور مقادیر مختلف ید

با توجه به شکل (۴) با افزایش مقدار ید از ۲۰ ا/g ۸/۰، میانگین اندازه ذرات موجود در سوسپانسیون کاهش و سپس با بیش تر شدن میزان ید، میانگین اندازه ذرات به صورت جزئی افزایش یافته است. به علاوه با توجه به شکل (۵) افزایش مقدار ید از ۲۰ ایش مقدار ید باعث افزایش مقدار پتانسیل زتا شده است. اما افزایش بیش تر مقدار ید باعث کاهش جزئی مقدار پتانسیل زتا می شود. بنابراین کوچک ترین اندازه ذرات و بیش ترین مقدار پتانسیل زتا برای ذرات AI در استون، به سوسپانسیون حاوی A/۱ ید مربوط می شود. با توجه به این که تفاوت سوسپانسیونهای حاوی ۸/۰ و A/۱ ید از لحاظ میانگین اندازه ذرات و مقدار پتانسیل

زتا جزئی است و مقدار ۱/۲ g/l مقدار بهینه برای ذرات YSZ میباشد، مقدار ۱/۲ g/l ید برای رسوبدهی هم زمان دو پودر انتخاب شد.



شکل (۵): نمودار مقدار پتانسیل ز تا برای ذرات Al در استون در حضور مقادیر مختلف ید

با توجه به نتایج به دست آمده، سوسپانسیون حاوی هر دو پودر YSZ و آلومینیوم تهیه شد. غلظت پودر برای YSZ برابر ا/و ۱۰ و برای AI برابر AJ ۲ در نظر گرفته شد. به منظور همگن سازی اختلاط دو پودر، مخلوط پودرها پس از توزین با نسبتهای مذکور به مدت دو ساعت در یک محفظه پلیاتیلنی با گلولههای زیرکونیایی با سرعت Tom ۲۰۰ آسیاب خشک شد. فرآیند رسوبدهی در ولتاژهای ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۷ ۵۱ و زمان های ۱، ۲، شود.

از آنجا که فرآیند تشکیل رسوب بر روی الکترود یک پدیده سینتیکی است، نرخ رسوب ذرات رفتار چگالش آنها را تحت تاثیر قرار میدهد [۱۱]. بنابراین، برای به دست آوردن رسوبی با چگالی و ضخامت مناسب، پارامترهای فرآیند از قبیل ولتاژ اعمالی و زمان رسوبدهی باید بهینهسازی شوند. تغییرات وزن

پوشش به عنوان تابعی از ولتاژ اعمالی و زمان رسوبدهی در شکل (۶) نشان داده شده است.



ر ۲۰، نمودار تغییرات ورن پوشش به طوران کابغی از وشار احمالی و رسان رسوبدهی

همان طور که در شکل (۶) مشاهده می شود، با ثابت نگه داشتن زمان رسوب دهی، در ولتاژهای اولیه با افزایش مقدار ولتاژ اعمالی وزن پوشش به سرعت افزایش می یابد، اما رفته رفته نرخ افزایش وزن کاهش می یابد. علت این رفتار را می توان به سرعت زیاد ذرات در ولتاژهای بالا نسبت داد. سرعت بالای حرکت ذرات مانع از آرایش منظم ذرات در سطح الکترود و ایجاد پوشش متراکم می شود [۱۱]. به علاوه، بر خورد ذرات با سرعت بالا به ذرات از قبل رسوب کرده بر روی سطح الکترود، باعث کنده شدن برخی از این ذرات شده و نرخ افزایش وزن را کاهش می دهد [۱۸].

به علاوه، با توجه به شکل (۶) مشاهده می شود که با ثابت نگه داشتن ولتاژ اعمالی، در زمانهای رسوبدهی اولیه، با افزایش زمان رسوبدهی، وزن رسوب به سرعت افزایش مییابد. اما با افزایش زمان، نرخ افزایش وزن کاهش مییابد. دلیل این امر آن است که با افزایش زمان یک لایه عایق از رسوب بر روی

الکترود رسانا تشکیل میشود و باعث افت میدان الکتریکی در سیستم میشود [۱۹]. همچنین با افزایش زمان رسوبدهی، غلظت پودر در سوسپانسیون کاهش مییابد که در زمانهای رسوبدهی طولانی این امر نیز میتواند دلیلی برای کاهش نرخ افزایش وزن باشد.

شکل (۷) تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپ نوری از مورفولوژی سطح پوشش های تشکیل شده در ولتاژ ۷ ۳ و در زمانهای رسوب دهی مختلف را نشان می دهد. همان طور که در تصاویر مشخص است، با افزایش زمان رسوب دهی مقدار پوشش تشکیل شده بر روی الکترود زمینه افزایش یافته است، اما در هیچ کدام از پوشش های تشکیل شده در ولتاژ ۷ ۳ ذرات به طور کامل سطح الکترود را پوشش نداده اند. حتی در زمان ۵ دقیقه علی رغم تشکیل پوشش در قسمتهای پایینی الکترود، پوشش تشکیل شده در قسمتهای بالایی غیریکنواخت بوده و بعضی مناطق بدون پوشش باقی مانده اند. در واقع در این ولتاژ ذرات نیروی محرکه کافی برای حرکت در داخل سوسپانسیون به سمت الکترود را ندارند.

تصویر پوشش های تشکیل شده در ولتاژ ۷ ۶ و در زمان های مخلتف رسوب دهی در شکل (۸) نشان داده شده است. در بین نمونه های پوشش داده شده در ولتاژ های مختلف، بهترین کیفیت متعلق به پوشش های تشکیل شده در ولتاژ ۷ ۶ است. پوشش های تشکیل شده در این ولتاژ عاری از هر گونه ترک و حفره در سطح خود هستند. اما با افزایش رسوب دهی به مقادیر بیش از ۳ دقیقه، به دلیل افزایش بیش از حد ضخامت پوشش قسمت هایی از آن کنده می شود.

شکل (۷): تصاویر ماکروسکوپی و میکروسکوپ نوری از مورفولوژی سطح پوشش های تشکیل شده در ولتاژ ۷۳ و زمان رسوب دهی: (الف): ۱ دقیقه، (ب): ۲ دقیقه، (ج): ۳ دقیقه، (د): ۴ دقیقه و (ه): ۵ دقیقه



شکل (۸): تصاویر پوشش های تشکیل شده در ولتاژ ۷۶ و زمان رسوب دهی: (الف): ۱ دقیقه، (ب): ۲ دقیقه، (ج): ۳ دقیقه، (د): ۴ دقیقه و (ه): ۵ دقیقه

باعث آرایش نامنظم ذرات و ایجاد پوشش غیرمتراکم می شود. در نتیجه سطح پوشش ایجاد شده ناصاف و غیریکنواخت خواهد بود. شکل (۹) پوشش های تشکیل شده در ولتاژهای ۹، ۱۲ و ۱۵۷ و زمان رسوبدهی ۱ دقیقه را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود این پوشش ها دارای سطح غیریکنواخت و دارای ترک هستند. علاوه بر پوشش های تشکیل شده در زمان رسوب-دهی ۱ دقیقه، همه پوشش های تشکیل شده در این ۳ ولتاژ دارای سطح غیریکنواخت و ترک دار بودند.



شکل (۹): تصاویر پوشش های تشکیل شده در ولتاژهای: (الف): ۷ ۹، (ب): ۱۲ ۷ و (ج): ۷ ۱۵ ، در زمان رسوب دهی ۱ دقیقه

با توجه به نتایج به دست آمده، پوشش ایجاد شده در ولتاژ V ۶

همانطور که پیش تر گفته شد، افزایش بیش از حد ولتاژ اعمالی

و زمان رسوب دهی ۳ دقیقه به عنوان پوشش خام بهینه انتخاب شد. تصویر SEM از ریز ساختار و مقطع عرضی این پوشش در شکل (۱۰) نشان داده شده است. همان طور که در تصویر مشخص است، ذرات AI در بعضی مناطق به صورت متمایز دیده می شوند که به دلیل مور فولوژی ورقه ای این ذرات و تفاوت اندازه ذرات AI و SZY مورد استفاده است، اما سطح این نمونه عاری از هر گونه ترک و حفره است.

شکل (۱۰–ب) تصویر SEM مقطع عرضی این نمونه را نشان میدهد. بر اساس این تصویر ضخامت پوشش خام به دست آمده ۱۹/۶۳ μm.



شکل (۱۰): تصویر SEM از: (الف): ریزساختار و (ب): مقطع عرضی پوشش تشکیل شده در ولتاژ ۷ ۶ و زمان رسوبدهی ۳ دقیقه

شکل (۱۱) ریزساختار نمونه بهینه تفجوشی شده در دمای C°۰۰۰ را نشان میدهد. تشکیل گردنه و ایجاد مرزدانه بین ذرات تشکیل دهنده پوشش در این شکل مشهود است. این تصویر نشان میدهد که عملیات تفجوشی در دمای C° ۰۰۰۰ به مدت ۲ ساعت، پیشروی خوبی داشته و باعث کاهش تخلخل-ها و افزایش چسبندگی بین ذرات تشکیل دهنده پوشش شده است.



شکل (۱۱): تصویر SEM ریزساختار پوشش تفجوشی شده در دمای ۲ ۰۰۰۰ به مدت ۲ ساعت

٤- نتیجه گیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان
کر د:

۱- افزودن ید به سوسپانسیون ذرات YSZ و Al با حلال استون،
 باعث تولید یونهای ⁺H در سوسپانسیون می شود و جذب یون های ⁺H توسط اتم های اکسیژن موجود در سطح ذرات باعث
 بهبود پایداری ذرات در سوسپانسیون می شود.

۲- سوسپانسیون ذرات YSZ و AI در استون و در حضور g/l ۱/۲ ید برای رسوبدهی هم زمان پودرهای YSZ و AI مناسب تشخیص داده شد. در این سوسپانسیون ذرات YSZ دارای اندازه 2208, 1993.

- [7] O. Unal, T. E. Mitchell & A. H. Heuer, "Microstructures of Y2O3-stabilized ZrO2 electron beam physical vapor deposition coating on Nibased superalloys", Journal of American Ceramic Society, Vol. 77, pp. 984-992, 1994.
- [8] C. H. Chen, K. Nord-Varhaug & J. Schoonman, "Coating of yttria-stabilized zirconia (YSZ) thin films on Gadolinia-doped ceria (GCO) by the electrostatic spray deposition (ESD) technique", Journal of Materials Synthesis and Processing, Vol. 4, pp. 189-194, 1996.
- [9] K. Mehta, R. Xu & A. V. Virkar, "Two-layer fuel cell electrolyte structure by sol-gel processing", Journal of Sol-gel Science and Technology, Vol. 11, pp. 203-207, 1998.

[۱۰] ح. ملکی قلعه، ح. آقاجانی، م. محمودی، م. برجسته و ح. زمانی، "بررسی اتلاف حرارتی پوشش سد حرارتی نانوساختار ساخته شده به روش EPD"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۸ شماره ۲، ص. ۱۰۴–۹۹، ۱۳۹۳.

- [11]L. Bersa, & L. Meilin, "A review on Fundamentals and Applications of Electrophoretic Deposition (EPD)", Progress in Materials Science, Vol. 52, No. 1, pp. 1-61, 2007.
- [12] A. R. Boccaccini & I. Zhitomirsky, "Application of electrophoretic and electrolytic deposition techniques in ceramics processing", Current Opinion in Solid State and Materials Science, Vol. 6, No. 3, pp. 251-260, 2002.

[۱۳] ع. گلشنی عجب شیر و ح. آقاجانی، "رسوب دهی الکتروفورتیک (EPD) نانوذرات کاربید سیلیسیم (SiC)"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، سال ۱۰۰ شماره ۳، ص. ۱۱۱–۱۰۳، ۱۳۹۵.

- [14] K. K. Chew, S. H. Sharif Zein & A. L. Ahmad, "The corrosion scenario in human body: Stainless steel 316L orthopaedic implants", Natural Science, Vol. 4, No. 3, pp. 184-188, 2012.
- [15] De Riccardis & M. Federica, "Ceramic Coatings Obtained by Electrophoretic Deposition: Fundamentals, Models, Post-Deposition Processes and Applications", INTECH Open Access Publisher, 2012.

متوسط nm ۱۱۱/۶ و پتانسیل زتای ۵۰/۲ mV و ذرات A۱ دارای اندازه متوسط mm ۲/۶۵۸ و پتانسیل زتای ۷m ۱۶ هستند. ۳- با بررسی پوشش دهی در ولتاژها و زمانهای مختلف مشخص شد که نمونه پوشش داده شده در ولتاژ ۷ ۶ و زمان رسوب دهی ۳ دقیقه نسبت به بقیه پوشش ها وضعیت بهتری داشته و دارای سطح عاری از ترک و حفره و ریزساختار متراکم تری است. ۴- با بررسی سینتیکی رسوب دهی الکتروفور تیک در ولتاژها و زمانهای مختلف مشخص شد که در ولتاژ اعمالی ثابت با افزایش زمان رسوب دهی بیش تر، نرخ افزایش می یابد، اما یابد. همچنین، در زمان رسوب دهی ثابت با افزایش ولتاژ اعمالی یابد. همچنین، در زمان رسوب دهی ثابت با افزایش ولتاژ اعمالی وزن پوشش با ولتاژ افزایش می یابد و با بیش تر شدن مقدار ولتاژ اعمالی، نرخ افزایش وزن پوشش کاهش می یابد.

٥- مراجع

- [1] A. P. Mouritz, "Introduction to Aerospace Materials", Woodhead Publishing, USA, 2012.
- [2] X. Q. Cao, R. Vassen & D. Stoever, "Ceramic materials for thermal barrier coatings", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 24, No. 1, pp. 1-10, 2004.
- [3] S. M. Meier, D. K. Gupta & K. D. Sheffler, "Ceramic thermal barrier coatings for commercial gas turbine engines", Journal of Management, Vol. 43, No. 3, pp. 50-53, 1991.
- [4] R. A. Miller, "Thermal barrier coatings for aircraft engines: history and directions", Journal of Thermal Spray Technology, Vol. 6, No. 1, pp. 35-42, 1997.
- [5] U. B. Pal & S. C. Singhal, "Electrochemical vapor deposition of yttria-stabilized zirconia", Journal of Electrochemical Society, Vol. 137, pp. 2937-2941, 1990.
- [6] G. Z. Cao, H. W. Brinkman, J. Meijerink, K. J. De Vries & A. J. Burggraaf, "Pore narrowing and formation of ultrathin yttria-stabilized zirconia layers in ceramic membranes by chemical vapor/electrochemical vapor deposition", Journal of American Ceramic Society, Vol. 76, pp. 2201-

- [16]Z. Wang, P. Xiao & J. Shemilt, "Fabrication of composite coatings using a combination of electrochemical methods and reaction bonding process", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 20, No, 10, pp. 1469-1473, 2000.
- [17] D. Das & R. N. Basu, "Suspension chemistry and electrophoretic deposition of zirconia electrolyte on conducting and non-conducting substrates", Materials Research Bulletin, Vol. 48, No. 9, pp. 3254-3261, 2013.
- [18] K. T. Sullivan, M. A. Worsley, J. D. Kuntz & A. E. Gash, "Electrophoretic deposition of binary energetic composites", Combustion and Flame, Vol. 159, No. 6, pp. 2210-2218, 2012.
- [19] F. Chen & M. Liu, "Preparation of yttria-stabilized zirconia (YSZ) films on La0.85Sr0.15MnO3 (LSM) and LSM-YSZ substrates using an electrophoretic deposition (EPD) process", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 21, pp. 127-134, 2001.

٦- پی نوشت

- [1] Electrochemical Vapor Deposition
- [2] Chemical Vapor Deposition
- [3] Physical Vapor Deposition
- [4] Electrostatic Spray Deposition
- [5] Sol-gel
- [6] Electrophoretic Deposition

Fabrication of YSZ/Al composite coating on Incoloy 825 superalloy using electrophoretic deposition

Mojtaba Ahmadi¹, Hossein Aghajani^{2,*}

1- M.Sc., Department of Materials Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2- Associate Professor, Department of Materials Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran *Corresponding author: h aghajani@tabrizu.ac.ir

Abstract

In this research, Fabrication of YSZ/Al composite coating on Incoloy 825 superalloy using electrophoretic deposition has been investigated. Dispersion of YSZ and Al particles suspension in acetone in presence of iodine, as a dispersant, was studied by particle size and zeta potential measurement. According to the results, the suspension containing 1.2 g/l iodine has been chosen for electrophoretic co-deposition of YSZ and Al particles. Mean diameter of YSZ and Al particles in this suspension was measured 111.6 nm and 2.658 μ m and zeta potential values of these particles were measured 50.2 and 16 mV, respectively. In order to investigate the influence of applied voltage and deposition time on the quality of formed deposit, electrophoretic co-deposition has been carried out at different voltages and deposition times. Results revealed that the deposit formed at voltage of 6 V and deposition time of 3 min had uniform and crack-free surface. SEM image showed that this coating had thickness of 19.63 μ m.

Keywords: YSZ, Aluminum, Electrophoretic Deposition, Zeta Potential.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Mojtaba Ahmadi, Hossein Aghajani, Fabrication of YSZ/Al composite coating on Incoloy 825 superalloy using electrophoretic deposition, in Persian, New Process in Material Engineering, 2019, 12(4), 129-139.